

A2

NiFe / TbCo 박막 자기 특성의 컴퓨터 시뮬레이션

숭실대학교

서정교*, 조순철

COMPUTER SIMULATION OF MAGNETIC PROPERTIES OF NiFe AND TbCo BILAYER

Soong Sil University

J. Seo*, S. Jo

1. 서 론

고밀도 재생 헤드로 사용되고 있는 자기저항 헤드는 출력 파형의 비선형과, 잡음(Barkhausen Noise)이 크다는 단점이 있다. 잡음은 단자구 상태로 만들어 제거할 수 있으며, 출력 파형의 비선형은 수직 방향으로 바이어스를 인가해서 제거 할 수 있다. 이 바이어스를 인가하기 위해서 TbCo 박막을 증착 시키는데, 본 논문에서는 이렇게 증착된 이층 박막의 자기 특성을 시뮬레이션 하였다. 특히 천이영역 두께의 변화에 따른 자기이력 곡선의 변화를 조사했으며, 직접 RF diode 스퍼터링 방법으로 제조한 박막의 자기이력 곡선과도 비교하였다.

2. 시뮬레이션 방법

소자를 충분히 크게 만들어서 감자장 효과를 무시할 수 있는 경우, 이층박막에는 이방성 에너지, 교환 에너지, Zeeman 에너지가 존재하게 되고, 이 에너지를 최소로 만드는 방향으로 자화가 분포된다[1]. 이 조건을 만족하는 자화의 분포가 각 박막 내부에서는 식(1)로 표시되고, 식(2)는 계면에서의 자화 분포를 표시한다.

$$K \sin(2\theta) - 2A \frac{d^2\theta}{dz^2} + H_a M_s \sin(\theta - \theta_h) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{d\theta_i}{dz} = \frac{K_i}{2A_i} \sin(\theta_{2i} - \theta_{1i}) \quad (2)$$

여기서 K , M_s , H_a , A , K_i 는 이방성 상수, 포화자화, 인가 자장, 자기 교환상수, 계면 교환결합상수이다. 각 층에서의 자화를 나타내기 위해서, $\cos \theta$ 를 m_x , $\sin \theta$ 를 m_y 로 표시하고 각각은 각 층에서의 정규화된 자화값을 나타낸다. θ 는 자화용이 방향과 자화방향 사이의 각이고, θ_h 는 자화용이 방향과 인가 된 자장 사이의 각이다. 위의 식의 해를 구하기 위해서 Newton 법과 Gauss Seidel 방법을 사용하였으며, 오차의 한계를 10^{-8} 이하로 하였다. 자장이 인가되지 않았을 때, 초기 자화는 자화용이 방향으로 놓여져 있고, 자장은 자화용이 방향의 반대로 가해졌다고 가정했다.

3. 시뮬레이션 결과 및 검토

Fig. 1, Fig. 2 는 TbCo 두께 800 Å, $K_{TbCo} = 3 \times 10^5$ erg/cm³, $A_{TbCo} = 4 \times 10^{-5}$ erg/cm 를 조건으로 한 시뮬레이션의 결과이다. Fig. 1에서 실선은 계면 교환결합상수 $K_i = 40$ erg/cm² 일때, 점선은 $K_i = 0.4$ erg/cm² 일때의 자기이력 곡선이다. Fig. 2는 $K_i = 40$ erg/cm² 일때, 인자된 자장을 변수로 두께에 따른 자화분포를 나타내었다. Fig. 3은 TbCo 천이영역의 두께에 따른 자기이력 곡선의 변화를 나타내고, 천이영역의 두께가 얇을 때와 계면 교환결합상수가 작을 때가 비슷한 곡선을 나타낼 수 있으며, 두께가 두꺼울수록 자기이력 곡선이 벌어지는 것을 볼 수 있다. Fig. 4는 Perkin Elmer 2400 8L RF 스퍼터를 사용해서 NiFe 470 Å, TbCo 2400 Å 으로 제작한 박막의 자기이력곡선이다. 이 곡선은 Fig. 1에서 보인 $K_i = 0.4$ erg/cm² 일때의 곡선과 비슷하다.

4. 결 론

본 연구는 시뮬레이션에 의해 박막의 자기이력 곡선과 자화의 분포상태를 미리 예측 할 수 있게 하며, 제작한 박막의 자기이력 곡선으로 측정할 수 없는 계면 교환결합상수등을 추정하는데 이용할 수 있을 것으로 사료된다.

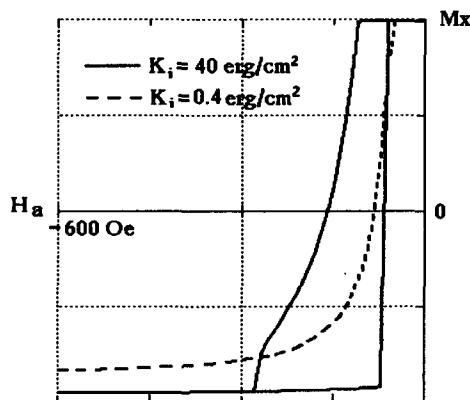


Fig. 1. M-H curve variations with interfacial exchange constant.

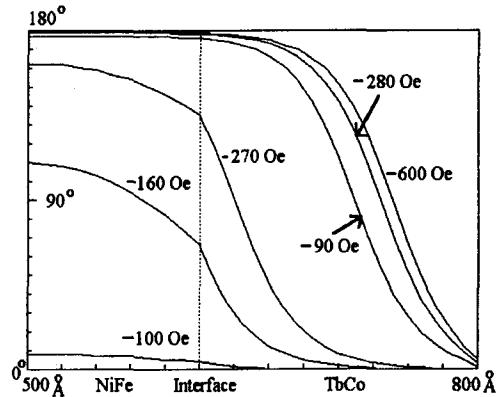


Fig. 2. Magnetization distribution in the NiFe/TbCo bilayer as the applied field is varied ($K_i = 40 \text{ erg/cm}^2$).

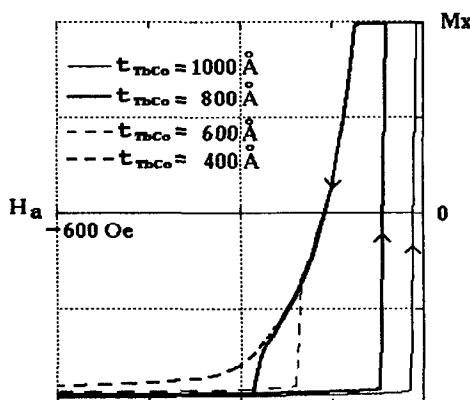


Fig. 3. M-H curve variations with TbCo transition layer thickness.

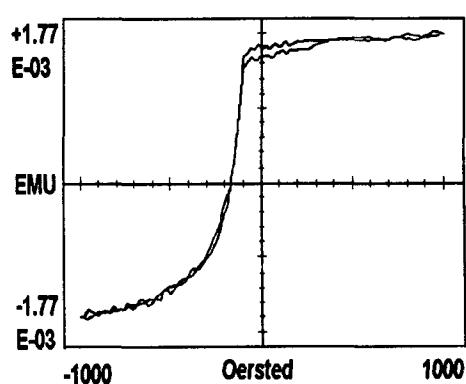


Fig. 4. Measured M-H curve. Sample is made by RF-diode sputter with thickness of 470 Å NiFe and 2400 Å TbCo.

5. 참고문헌

- [1]. N. Smith, W. C. Cain, J. Appl. Phys., 69(4), pp. 2471-2479, (1991).